

# GLANZOX

Pulidor de silicio



This photograph is an image.  
Esta fotografía es una imagen.

## GLANZOX

With the increasing integration of semiconductor devices and the larger size of wafers, a damage-, haze- and heavy metal contamination free, flat, as well as nanotopography mirror-like silicon surface is essential. Fujimi's GLANZOX series was developed to meet such requirement. GLANZOX polish consists of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients. This product results in an almost perfectly polished surface. In response to the recent demand for considerable reductions in the metal impurities that affect device characteristics, higher-grades of polish containing ultra-pure colloidal silica have been developed.

## GLANZOX

Debido a la creciente integración de dispositivos semiconductores y al mayor tamaño de las obleas, es esencial conseguir una superficie nanotopográfica de silicio similar a un espejo que sea plana, sin turbidez, sin contaminación y que no esté dañada. La serie GLANZOX de Fujimi se desarrolló para dar respuesta a este requerimiento. El pulidor GLANZOX está formado por silicio coloidal dispersado en un compuesto químico de ingredientes especiales. Este producto permite crear así una superficie pulida casi perfecta. Con el fin de responder a la reciente demanda para reducir de manera considerable las impurezas del metal que afectan a las características de los dispositivos, se han desarrollado materiales de pulido de mayor calidad con silicio coloidal ultrapuro.

### Typical Physical Properties of GLANZOX

### Propiedades físicas típicas de GLANZOX

Item	Elemento	Type	Tipo	1103	1302	1304	3500
Main component	Componente principal			Ultra-pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> ultrapuro (coloidal)	pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> puro (coloidal)	pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> puro (coloidal)	
Content of SiO <sub>2</sub> (%)	Contenido de SiO <sub>2</sub> (%)			17,5	18,5	18,5	—
PH				11,4	11,4	11,4	10,1
Specific gravity	Gravedad específica			1,1	1,1	1,1	1,0
Average particle size (nm)	Tamaño medio de las partículas (µm)			35	35	9	—
Application	Aplicación			For First polishing Para el primer pulido	For First polishing Para el primer pulido	For First polishing Para el primer pulido	—
Standard Net weight	Peso neto estándar			17 kg 17 kg	10 kg 10 kg	10 kg 10 kg	10 kg 10 kg
Drum	Tambor			220 kg 220 kg	220 kg 220 kg	220 kg 220 kg	200 kg 200 kg

Item	Elemento	Type	Tipo	3900	3900RS	3101	3100M
Main component	Componente principal			Ultra-pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> ultrapuro (coloidal)	pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> ultrapuro (coloidal)	pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> ultrapuro (coloidal)	pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> ultrapuro (coloidal)
Type of product	Tipo de producto			9,1	9,1	4,5	9,1
PH				10,5	10,5	10,6	10,3
Specific gravity	Gravedad específica			1,05	1,05	1,03	1,05
Average particle size (nm)	Tamaño medio de las partículas (µm)			35	35	35	35
Application	Aplicación			Final For Final polishing Final Para el pulido final	Final For Final polishing Final Para el pulido final	Final For Final polishing Final Para el pulido final	Final For Final polishing Final Para el pulido final
Standard Net weight	Peso neto estándar			10 kg, 20 kg 10 kg, 20 kg	10 kg 10 kg	10 kg 10 kg	10 kg 10 kg
Drum	Tambor			200 kg 200 kg	200 kg 200 kg	200 kg 200 kg	200 kg 200 kg

# Serie GLANZOX E

Pulidor de cantos de silicio

## ■ GLANZOX E-Series

With the increasing integration of semiconductor devices, wafer surfaces must be cleaned more efficiently than ever. To prevent dusting due to transportation and handling, and reinforcement of the edge surface, mirror-finishing of the edge surface must be performed during the wafer manufacturing process. GLANZOX E-Series high-efficiency polish was developed exclusively for mirror finishing of wafer edge surfaces. It is comprised of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients, and is superior in terms of cleanability after polishing.

## ■ Серия GLANZOX E

Con la creciente integración de dispositivos semiconductores, las superficies de las obleas deben limpiarse con la mayor eficacia posible. Para evitar la acumulación de polvo causada por el transporte y manipulación y para reforzar la superficie de los cantos, debe conseguirse que estos tengan un acabado tipo espejo durante el proceso de fabricación de la oblea. El pulidor de alta eficacia de la serie GLANZOX E se ha desarrollado exclusivamente para lograr un acabado de espejo en las superficies de las obleas. Esta formado por silicio coloidal disperso en un líquido de ingredientes especiales que ofrece características superiores en cuanto a lavabilidad después del pulido.

### Typical Physical Properties of GLANZOX E-Series

### Propiedades físicas típicas de la serie GLANZOX E

Item	Elemento	Type	Tipo	E301	E303	E304
Main component	Componente principal			SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> (coloidal)	pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> puro (coloidal)	pure SiO <sub>2</sub> (colloidal) SiO <sub>2</sub> puro (coloidal)
Content of SiO <sub>2</sub> (%)	Contenido de SiO <sub>2</sub> (%)			35	35	40
PH				11,5	10,6	11,6
Specific gravity	Gravedad específica			1,24	1,24	1,28
Average particle size (nm)	Tamaño medio de las partículas (µm)			55	55	35
Kind of water	Tipo de agua			bare silicon & oxide silicio y óxido en bruto	bare silicon & oxide silicio y óxido en bruto	bare silicon silicio en bruto
Standard Net weight	Peso neto estándar			18 kg 18 kg	20 kg 20 kg	18 kg, 20 kg 18 kg, 20 kg
Drum	Tambor			240 kg 240 kg	240 kg 240 kg	240 kg 240 kg